

題號： 171

國立臺灣大學 111 學年度碩士班招生考試試題

科目： 活動義齒學

題號：171

節次： 4

共 1 頁之第 1 頁

1. 請描述可能影響局部活動義齒 direct retainer 彈性的因素 (10%)。
2. 請描述局部活動義齒中 swing-lock denture 使用的時機 (10%)。
3. 近年來，牙根植體慢慢被應用於局部活動義齒的設計中，請問你對於使用植體協助局部活動義齒的想法以及會如何利用牙根植體於活動義齒的設計。(10%)
4. 臨床上，如何判斷一副 Class I 的局部活動義齒需要重新襯底(reline)? (10%)
5. 請問在遠端延伸活動義齒 (distal extension removable partial denture) 使用 RPI 設計時，Krol 與 Kratochvil 在觀念及設計上有何不同之處。(10%)
6. 請簡述 Gothic arch tracing 在全口義齒製作的臨床目的，並說明 lab side 和 clinical side 的操作步驟。(10%)
7. 何謂 combination syndrome，臨床上常發生在什麼樣的狀況下，製作補綴物時該注意什麼事項來改善。(10%)
8. 臨床上 overdenture 易出現 denture base 斷裂的原因為何？義齒製作時，該注意哪些事項以減少發生機率。(10%)
9. 配戴新全口義齒時，若患者提到上下顎的義齒稍一運動就會脫落，並且容易咬到臉頰和舌頭，請問有哪些原因容易造成？臨床上該如何改善？(10%)
10. 請就你的了解，簡單說明一下 digital workflow 運用在全口義齒的狀況，並說明該製程技術的優點和限制。(10%)

試題隨卷繳回